

## 5. 集束イオン／電子ビーム加工観察装置



### 【仕様】

#### FIBについて

加圧電圧：1～40 kV、最大ビーム電流 50nA 以上、SIM 像分解能 5 nm  
倍率（ディスプレイ上）：60～250,000 倍

#### SEMについて

加速電圧：0.5～30 kV

二次電子像分解能：1.0 nm (15 kV)

倍率：250～800,000 倍（高倍率モード）、70～2,000 倍（低倍率モード）

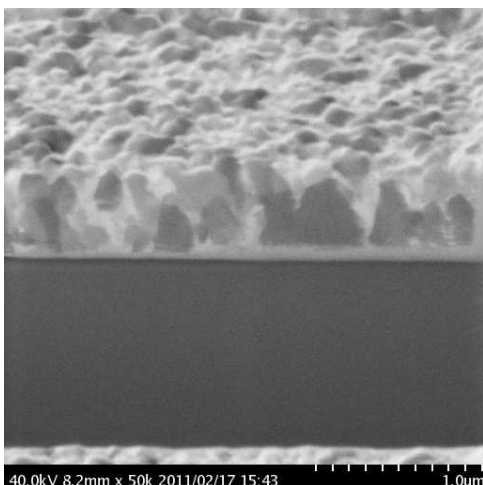
共通：試料サイズ 50mm 径

### 【特徴】

FIB-SEM は、優れた 40kV Ga イオン FIB カラムと超高分解能ショットキーFE-SEM を統合しています。FIB-SEM は 2 つのサンプルステージを搭載しており、その 1 つは従来型のユーセントリックステージ、そしてもう 1 つは STEM/TEM システムの究極の安定性とサンプルホルダー互換性を備えたオプションの TEM ハイパスステージです。断面は、収差補正顕微鏡による観察を可能とするため 50nm 厚以下のダメージレスサンプルを得るために低電圧・低電流条件(1kV)下で最終仕上げされます。

### 【観察例】

パーマロイの観察（境界面）



パーマロイの観察（段差）

